

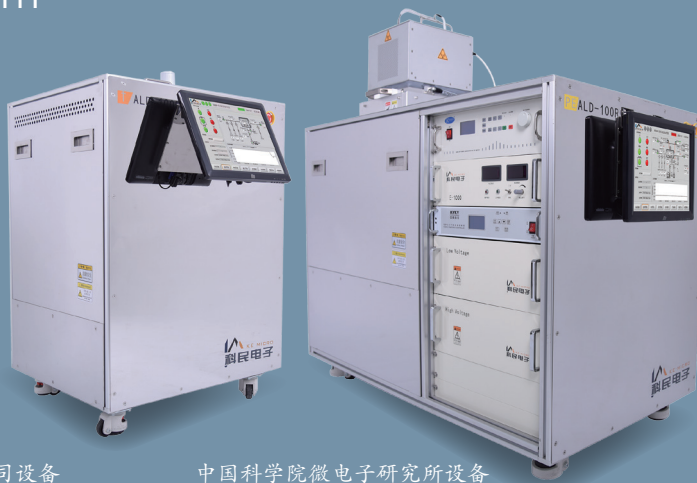
原子层沉积系统

Atomic Layer Deposition System

TALD.PEALD



中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司设备



中国科学院微电子研究所设备

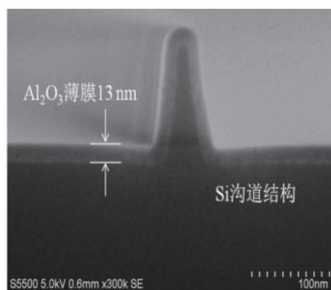
主要技术与性能指标

- 非均匀性：氧化铝 $\leq \pm 1\%$
- 沉积材料：氧化物、氮化物、单质等
- 气路：最大 6 路液态前驱体源

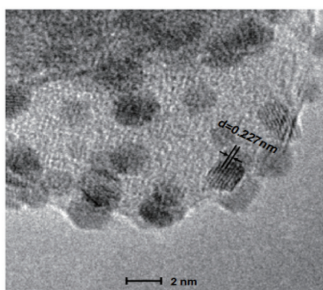
主要应用

微电子器件、光伏、催化等领域的薄膜沉积

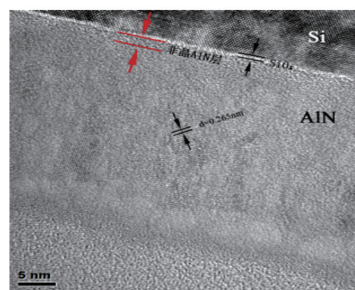
代表性应用成果



氧化铝薄膜沉积



铂单质颗粒沉积



氮化铝薄膜沉积

主要用户单位	清华大学、北京大学、中国科学院半导体研究所、国家纳米科学中心、中国科学院长春光学精密机械与物理研究所、中国科学院物理研究所、天津大学、南开大学等		
研制单位	中国科学院微电子研究所、嘉兴科民电子设备技术有限公司、中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司		
联系方式	何老师 010-62049399, 13581817539 万向明 024-23826819, 13998191237	hemeng@ime.ac.cn wanxm@sky.ac.cn	